

耐酸耐アルカリ6インチPtfе円形ウェハキャリア 半導体洗浄バスケット

カスタマイズ可能

商品番号: PL-CP207



前書き

半導体洗浄用に設計された高純度6インチPTFE円形ウェハキャリア。ピラニア溶液やHFエッチングに対応する優れた耐酸・耐アルカリ性を誇ります。精密加工された完全カスタマイズ可能なバスケットは、過酷なウェットケミカルプロセス、浸漬バス、超音波リンス中に基板を安全に搬送します。

詳細を学ぶ

用途	説明	主なメリット
RCA洗浄プロセス	SC-1およびSC-2溶液を使用して、シリコンウェハから有機残渣、薄い酸化膜層、イオン汚染を除去するために使用されます。	高い耐熱性および耐薬品性により、加熱バス浸漬中のキャリアの劣化を防ぎます。
ピラニアエッチング	多量の有機物を除去するために、硫酸と過酸化水素の混合液中でウェハを処理します。	攻撃的な酸化環境に対する卓越した耐性により、機器の長寿命を保証します。
フッ化水素（HF）酸ディップ	様々な濃度のHFを使用して、シリコン表面から犠牲酸化膜層または自然酸化膜を除去します。	材料の純度により、敏感なエッチング環境への金属イオンの混入を防ぎます。
CMP後リンス	化学機械研磨（CMP）に続く洗浄サイクルでウェハを搬送し、スラリー粒子を除去します。	滑らかで非粘着な表面は、微粒子の閉じ込めを防ぎ、効果的な超音波洗浄を促進します。
太陽電池製造	テクスチャ形成およびリン拡散工程中に、6インチ単結晶または多結晶シリコンウェハを処理します。	堅牢な構造は、過酷な工業生産ラインでの高スループットをサポートします。
フォトリソグラフィ	溶媒および専用のストリッパを使用して、フォトレジストの現像および剥離中に基板をサポートします。	普遍的な溶媒互換性により、キャリアフレームの膨潤や軟化を防ぎます。
超音波洗浄	高精度汚染除去のために、超音波またはメガソニックバスで繊細なコンポーネントを搬送します。	構造的剛性により、音響エネルギーをウェハ表面に効率的に伝達できます。
化合物半導体エッチング	光電子デバイス製造のために、専用の化学混合液中でGaAs、InP、またはSiCウェハを処理します。	カスタマイズ可能なスロット形状により、様々なウェハ厚や脆弱な基板材料に対応できます。

パラメータ	PL-CP207の仕様詳細
型番	PL-CP207
材質構成	高純度バージンPTFE（カスタムPFAオプション利用可能）
対応ウェハサイズ	6インチ / 150mm径
幾何学構成	円形洗浄バスケット / フラワーバスケットタイプ

パラメータ	PL-CP207の仕様詳細
耐薬品性	普遍的な耐性（酸、塩基、溶媒、酸化剤）
耐温度性	極低温から高温処理に適用可能
カスタマイズ能力	寸法、スロット数、ハンドル構成の完全カスタマイズ可能
表面仕上げ	精密加工、超滑らか、非多孔質
バッチ処理能力	クライアントの特定のウェハ枚数要件に合わせてカスタム設計
製造方法	特注CNC加工 / カスタムファブリケーション